



NU-205 3元マグネトロンスパッタ装置

島津製作所製 HSR-522

登録ファイル

X PDL (Process Data Log)ファイル **必須です**

(以下より該当するPDLファイルをダウンロードし、**成膜条件を入力してください**)

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>



成膜時の基板配置の撮影画像など
(ファイル形式：.jpg, .png, .tiff) **必須ではありません**



添付ファイル



無し

【注意事項】

- ・一日に複数のサンプルを作製した場合は、複数ファイルを同時に登録することを推奨します。**試料番号を入れるなど後で識別できるファイル名で保存**し、登録ファイルへ一度に登録してください。
- ・サンプルの内容が大幅に異なる場合は、別々に登録（連続登録）を行ってください。（ユーザーの裁量で分け方を決めていただいても構いません）
- ・**原則、実施日毎の登録をお願いします。**

【例】AI膜を2枚、Au膜を2枚作製した場合

- ①PDLをAI膜で2つ、Au膜で2つ作製します。（試料番号わかるように）
- ②AI膜のPDLを2つ同時登録。Au膜のPDLは**連続登録**で2つ同時に登録します。（連続登録については、データ登録マニュアル[6/8]を参照ください）

※ 登録開始を押して構造化が始まると、**登録ファイルは追加・編集できません。**（追加・編集したい際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください）

お問い合わせ hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jpARIM名古屋大学
加工・デバイスプロセス分野
データ登録担当：秦

2024/11/29